

出願人:山口大学 発明者:本多謙介 WO2013-065315 特許第6083676号

発明の名称:窒素がドープされたアモルファスシリコンカーバイト よりなるn型半導体及びn型半導体素子の製造方法



利用•用途•応用分野

無料開放特許

太陽光発電、電力変換デバイス、携帯電話の基地局等

目的 課題

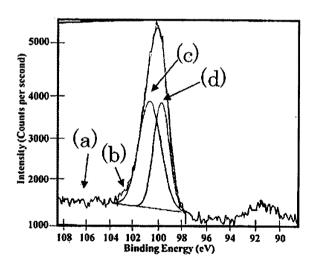
発光波長が相互に異なる複数の 半導体発光層を同一基板上に形成された新規な多波長発光素子 及びその製造方法を提供する。

研究概要・アピールポイント

シリコンカーバイトに後から 窒素ガスを拡散又は イオン注入する方法に比べて、 安価に且つ、比較的高濃度で 窒素がドープされた バンドギャップの広い高耐熱性、 高耐薬品性の高電圧用の MOSFEIや ショットキーダイオード或いは 光電素子に用いられる n型半導体素子を得ることが できる。

解決ポイント

原料としてシラザン化合物と分子中に窒素原子を持たないアルキルシラン又はアルコキシシランを用い、シリコンカーバイトの合成と同時に不純物の窒素原子を導入することで、容易に且つ極めて有効に窒素をドープしたアモルファスシリコンカーバイドよりなるn型半導体を合成できる。



NドープSiCのXPSスペクトルSi 2pピークの詳細解析結果(a)実測のスペクトル波形

- (b)Gaussian関数によるフィッティング結果(c)と(d)の和
- (c)ピーク分離後のCと結合したSi 2pピーク
- (d)ピーク分離後のSiと結合したSi 2pピーク

◆ お問合せ先 ◆

有限会社山口ティー・エル・オー TEL: 0836-22-9768 E-mail:tlojim@yamaguchi-u.ac.jp